Untitled

CLIPPEDIMAGE= JP356113470A

PAT-NO: JP356113470A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 56113470 A

TITLE: MANUFACTURE OF INK JET HEAD

PUBN-DATE: September 7, 1981

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

∄ •1

UEISHI, YUKIHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

RICOH CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP55017577

APPL-DATE: February 15, 1980

INT-CL (IPC): B41J003/04; B05B001/02; G01D015/18

US-CL-CURRENT: 29/890.1

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability of an ink jet head and increase printing

accuracy by a method wherein glass paste with the low melting point is printed

on a multinozzle plate consisting of a silicon monocrystal in a scree n shape,

the paste is melted and the multinozzle plate and liquid-chamber structures are connected.

CONSTITUTION: The surfaces of a multinozzle plate 1, in which a silico ${\tt n}$

monocrystal wafer is photoetched in an anisotropic shape and a plural ity of

nozzles 2 are made up, and glassy liquid-chamber strutures 3 are grease-removed, washed and dried. Glass paste 5 with the low melting point is

printed on a connecting surface of the multinozzle plate in a screen s hape in

beltlike patterns surrounding each nozzle. The glass paste printed is

Page 1

Untitled

dried

for $15\min$ at $125\&\deg$; C, and a solvent section is previously evaporated . The

liquid-chamber structures and the multinozzle plate are stacked, baked (for

15∼ 30min at 380∼ 450° C), and connected.

COPYRIGHT: (C) 1981, JPO&Japio

(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭56—113470

⑤ Int. Cl.³
B 41 J 3/0⁴

識別記号 103 庁内整理番号 7231—2 C 7112—4 F 43公開 昭和56年(1981)9月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

B 41 J 3/04 B 05 B 1/02 // G 01 D 15/18

6336—2F

囫インクジェットヘッドの製造方法。

顧 昭55—17577

願 昭55(1980)2月15日

仍発 明 者 上石幸拓

@特

22出

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

切出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号

個代 理 人 弁理士 星野恒司

外1名

別 細

発明の名称 インクジェットヘッドの製造方法

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明で

本発明は、インクジェット 記録装置における改 良されたマルチノズルインクジェットヘッドの製 造方法に関するものである。

従来、この種の装置は、複数のノメルを配設したマルチノメル版とインクに振動を与えるための振動子を有する液室を設けた液室構造体とを接合し、前記複数のノメルからインク摘を噴射して記録体に画像、文字等を記録するものであるが、マルチノメル板に設けた各ノメルの形状や寸法が均一でないとインク摘の大きさや噴射方向にばらつきが生し、記録品質を著しく低下させる。

これに対し、シリコン単結晶ウェーハを異方性ホトエッチングして均一なノズルを形成するようにしたマルチノズル板が知られている(例をば、特開昭 51-87924 号公報参照)。このマルチノズル板は、結晶の(100)面が表面に平行に配向するように切り出されたシリコンウェーハを、例をはエチレンジアミンとピロカテニールと水とを含む異方性エッチング液を使用して孔あけするとウェーハ表面に対して特定の傾斜角を有するピラミッド形の孔が形成され、各ノズルの形状や寸法が均一になるという特徴がある。そしてこのマルチ

- 2 -

特開昭56-113470 (2)

ノズル 板と 液 室 構 造 体 とを エポキシ 樹脂 の 如 き 有 機 物 接 着 剤 を 用 い て 接 着 し た イン ク ジェット ヘッ ド が 提 案 さ れ て い る 。

しかしながら、マルチノズル板と液室構造体とを有機物接溶剤で接合した場合、インク液が一般にアルカリ水溶液(pH ≈ 10)であるため時間の経過とともに接溶剤を膨潤させ、接合部が劣化するので借頼性が極めて低い。

また、シリコンの無膨張係数が略 4.2×10⁻⁶/で であるのに対し、エボキン樹脂のそれは 30×10⁻⁶ ~ 65×10⁻⁶/でと 1 桁の差があり、 さらに大きい無膨張係数を有する金属の液室構造体に接合すると、使用状態で加わるヒートサイクルによって接合部に応力がかかり、 次 第に劣化して接合部にクラックが入ったり、 ついにはシリコン単結晶のマルチノメル板を破壊するに至る。

この熱膨張係数の差による接合部やマルチノメル板の破壊は、マルチノメル板の面積が通常の半導体累子に比較して非常に大きいので、半導体素子のダイボンディングに用いられる共晶合金やは

- 3 -

において無彫張係数の差による応力がかかり、マ ルチノズル板を破壊することがある。

接合し程を詳述すると、まず、マルチノズル板 1と被室構造体3の表面を脱脂洗浄して乾燥する。 次に、・ルチノズル板1の接合面に各ノズル2を んだのろう付けによる接合でも同様に発生する。 実験の結果、シリコンの無膨張係数と結合材また は液室構造体のそれとの差が 5×10⁻⁶/C 以上ある とクラック等が発生することが判明した。

さらに、有機物接着剤は硬化促進のために硬化剤が添加されているので常温においても硬化が進み、そのため作業性が悪く、量産性に劣る。また、有機物接着剤は加熱硬化の過程において流動し場く、ノメル部に流れて目づまりが発生したり、接着剤の厚さにはらつきを生し、被室構造体とノメル板との平行度が損なわれる等の欠点があった。

- 4 -

取り巻くような帯状のパターンで、低触点 リジスペースト 5 (例をば、 ESL 社製のシーリングリラスペースト 4017)をスクリーン印刷する。印刷した低融点 ガラスペースト 5 は 125 で・15 分の乾燥で溶剤 分を予め蒸発させる。続いて、第2 図のように、液室構造体 3 とマルチノズル板 1 とを重ねて焼成 (380 ~ 450で・15~30分)し、接合する。

- 6 -

特開昭56-113470 (3)

るとともに、印刷したバターンは略その形状を維持して溶験するので各ノメル 2 の周囲における接合状態が一様になり、マルチノメル板 1 と 液室構造体 3 との平行度も保たれ、インクの噴射特性が均一になる等の効果がある。

. . .,

なお、本実施例では、低融点ガラスペーストをマルチノメル板に印刷したが、液室構造体の側に印刷してもよい。また、液室構造体の材質としてステフォイトやアルミナ等の磁器(熱彫張係数6×10⁻⁶~7×10⁻⁶/C)、コパール合金(熱彫張係数4.7×10⁻⁶/C)などを使用してもよい。

以上説明したように、本発明によれば、シリコン単結晶のマルチノメル板または液室構造体のいたがあるがあるとなるとなったがある。

第1図および第2図は本発明の1実施例の構成

を示す図で、第 1 図はマルチノメル板の接合 mi を示す図、第 2 図はインクジェットヘッドの部分の断面図である。

1 …… マルチノズル板、 2 …… ノズル、

3 …… 液室構造体、 4 …… 液室、

5 …… 低融点ガラスペースト。

特許出願人 株式会社 り ュー

代理人 星野 恒 司

鈴 木 和 夫 .

- 8 -



